

【6.6.4.1】韓国における特許を対象にした企業動向調査

Q

サムスン (SAMSUNG) の出願動向を把握したい。

1) 調査ツールの選択

韓国における特許は、韓国特許庁（以下、KIPO）が提供する KIPRIS、日本国特許庁（以下、JPO）が提供する「中韓文献翻訳・検索システム¹」、欧州特許庁（以下、EPO）が提供する Espacenet、世界知的所有権機関（以下、WIPO）が提供する PatentScope などに収録されており、いずれを利用してキーワード（以後 KW）検索や分類検索を行うことが可能である。調査ツールを選択する際には収録されているデータの範囲（対象国、地域、期間、言語など）、検索結果を表示する機能、データ出力機能など入手したい情報の種類やレベルに応じて最善のツールを選択したい。今回は統計分析機能が備わっている WIPO の PatentScope を利用した事例を紹介する。

2) 検索事例

PatentScope の検索画面は下記 URL から接続することができる。日本語版以外にもモバイル版、英語版、ドイツ語版、中国語版、韓国語版など複数のインタフェースが用意されている。また、検索画面には 4 つの検索モードが用意されているので目的に合わせてモードを選択する。

<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

◆検索モードの紹介

簡易検索：フルテキストや氏名(名称)など 8 種類の検索フィールドから 1 つを選んで検索を行う。

詳細検索：検索ボックスに検索語、検索式、フィールドコードなどを指定した検索構文を入力して、複数の条件を組み合わせた検索を行う。

構造化検索：発明の名称や要約など複数の検索フィールドでそれぞれ検索条件を指定し、それらの条件を組み合わせた検索を行う。

多言語検索：入力した検索用語を自動的に 12 言語に翻訳し、その全てを使って特許文献の検索を行う。

¹ URL：http://www.ckgs.jpo.go.jp/full_text からアクセスが可能。収録範囲は発行日ベースで 2003 年以降であるが、日本語 KW で名称、要約、請求項、全文を対象に検索が可能で、公報の内容についても日本語で確認ができる。



今回は、複数の検索項目を設定でき、より目的に近い検索ができることから「構造化検索」モードを選択した事例を紹介する。

◆調査目的および調査対象

調査対象例として下記の調査目的および対象企業を設定した。

調査目的：韓国において、ある企業の出願動向を確認する

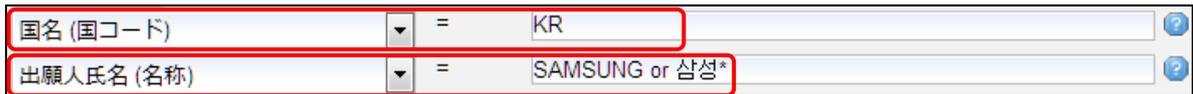
調査対象企業：SAMSUNG 社

◆予備検索・準備編

通常調査を行う際は、出願人名の揺らぎ・関連子会社の確認をする必要がある。SAMSUNG のように幅広い分野、複数のグループ会社を有する企業は、どの会社が調査したい技術を実施しているか、どういう名義になっているのかを確認する必要がある。今回は SAMSUNG グループ全体でどの様な出願傾向になっているのか、どの様な技術に多く出願しているのかを確認する調査と位置づけ、「SAMSUNG」のみで検索し、グループ会社を含めたグループ全体の傾向を調査する。また利用する出願人の言語は、韓国特許の場合、韓国語と英語表記が併記されているものがあるが、併記されていないものもあるため、より精度の高い調査を行う場合は、韓国語表記についても考慮する必要がある。インターネットで SAMSUNG 社のウェブサイトなどを参照すると、韓国語の名称（삼성）の存在がわかった。本手引書では SAMSUNG 社の英語表記とともに、韓国語表記も併せて利用する。

◆実践編

まず「構造化検索」モードを選択し、検索言語を「英語」に変更する²。しばらくするとプルダウンメニューが英語用に切り替わるので、それを確認してから左側のプルダウンメニュー（どの行でも良い）を「国名（国コード）」とし右側の検索ボックスに韓国の国コード【KR】と入力する。次いで「出願人氏名（名称）」に【SAMSUNG or 삼성*】と入力し、画面右下の「検索」ボタンをクリックする。



上記の検索を行った結果が下記のように表示される。「結果分析」のボタンをクリックすると統計結果が表示される。



² 本書においては KW 検索をしていないので言語を英語にする必要はないが、企業名に加え KW で絞り込んだ分析をする場合を想定し、本書では言語を英語に設定する手順を紹介している。

結果分析									
オプション ○ Table ● Graph ○ bar ● pie ● Line									
国名		国際特許分類 (メイン)		発明者 (筆頭)		出願人 (筆頭)		公開日	
国名 ⇅	No ⇅	IPC ⇅	No ⇅	氏名 (名称)	No ⇅	氏名 (名称) ⇅	No ⇅	日付 ⇅	No ⇅
Republic of Korea	261346	H01L	46993	김성훈	937	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	163388	2007	23602
		H04N	22977	이상훈	642	삼성전자주식회사	114101	2008	18279
		G06F	20842	강태경	573	윤종용삼성전자 주식회사	28807	2009	11403
		H04B	19078	박영준	532	SAMSUNG SDI CO., LTD.	21285	2010	10579
		G02F	17901	김동규	528	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.	17510	2011	10215
		G11B	10942	김성수	523	김광호삼성전자 주식회사	17297	2012	10649
		H04L	10401	이주호	503	삼성에스디아이 주식회사	16584	2013	11401
		H01J	9692	KANG, TAE KYOUNG	502	삼성전기주식회사	14528	2014	13219
		G09G	8852	김영수	458	삼성디스플레이 주식회사	8684	2015	14407
		G11C	7920	김성진	447	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	7809	2016	8713

この画面からは、IPC ランキングが分類コードと出願件数、出願人ランキングが出願人の名称と出願件数、そして公報の発行年ごとの出願件数が見てとれるので、具体的な内容を把握することができる。

「結果分析」の項目で、出願人（筆頭）ランキングの項目を見ると、下記のように英語表記と韓国語表記が混じった表示となっている。その理由は、PatentScope では出願人の韓国語表記と英語表記が併記されているためである。

出願人 (筆頭)	
氏名 (名称) ⇅	No ⇅
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	163388
<u>삼성전자주식회사</u>	114101
<u>윤종용삼성전자 주식회사</u>	28807
SAMSUNG SDI CO., LTD.	21285
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.	17510
<u>김광호삼성전자 주식회사</u>	17297
<u>삼성에스디아이 주식회사</u>	16584
<u>삼성전기주식회사</u>	14528
<u>삼성디스플레이 주식회사</u>	8684
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	7809

SAMSUNG ELECTRONICS の韓国語名

SAMSUNG ELECTRONICS の韓国語名

SAMSUNG SDI の韓国語名

SAMSUNG SDI の韓国語名

SAMSUNG ELECTRONICS の韓国語名

SAMSUNG DISPLAY の韓国語名

このランキングより、SAMSUNG ELECTRONICS、SAMSUNG SDI、SAMSUNG DISPLAY の出願が多いことがわかる。

このように初期設定は表形式となっているが、表示形式をグラフ形式に変更すれば、棒グラフや円グラフを表示させることができる。

オプション ● 表 ○ **グラフ** オプション ● **棒グラフ** ○ 円グラフ ● Line

Country | **Main IPC** | Main Inventors | Main Applicants | Publication Date

Countries

分析軸は国、メインIPC、メイン発明者、メイン出願人、公開日の5つ

表示モードは表形式とグラフ形式の2つのオプションでグラフの種類を選択する

表示モードでグラフを選択した場合には右側のオプションが有効になる

円グラフあるいは棒グラフを作成させるには、左側のオプションから「グラフ」を選択し、右側のオプションから「棒グラフ」または「円グラフ」を選択し、さらに分析軸を指定するのだが、企業動向調査としては次のような分析軸を指定する方法が有効である。

- ◆ Main IPC （注力している技術分野がわかる）
- ◆ Publication Date （出願の時期から、開発の変遷や将来動向がわかる）

例えば「グラフ」の「棒グラフ」を選択し、「Main IPC」をクリックすると、このようなグラフが作図される。



この結果、特に出願件数が多いのは「H01L：半導体装置,他に属さない電気的固体装置」であることがわかる。

参考として、上位の IPC サブクラスの定義を記載する。

IPC	定義
H01L	半導体装置,他に属さない電気的固体装置
H04N	画像通信,例.テレビジョン
G06F	電気的デジタルデータ処理
H04B	伝送
G02F	光の強度,色,位相,偏光または方向の制御
G11B	記録担体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記録
H04L	デジタル情報の伝送,例.電信通信
H01J	電子管または放電ランプ
G09G	静的手段を用いて可変情報を表示する表示装置の制御のための装置または回路
G11C	静的記憶



またオプションで「棒グラフ」を選択し、さらに「Publication Date³」をクリックすると、時系列に整理された年次推移グラフが作図される。このグラフからは、2002年から2006年にかけて出願件数が増加したが、その後2007年から2009年にかけて急激に件数が減少したことがわかる。2009年から2012年まで

³初期設定では10年分しか表示されないため、設定を変更している。変更は、画面上部の「オプション」>「設定」>「結果表示」をクリックし、「グループ毎表示件数（分析）」の値をプルダウンメニューより適宜選択することで実行できる。この図は値を20に変更して作図したものである。

は横ばい傾向になり、さらに 2012 年から 2015 年にかけては件数が増加傾向にある。

Web 検索を行い上記の減少した理由を探したが、根拠を明示する情報は見つからなかったが、何らかの方針転換が図られたものと考えられる。

◆まとめ

このように、PatentScope を利用して名義検索を行い、結果分析機能を活用すれば、企業の知的財産戦略の概要を把握することができる。

より複雑・高度な分析を行いたい場合には、HIT した文献の書誌データ、特に出願日・公開日・IPC のデータをダウンロードし、これを表計算ソフトなどで加工することで 2 軸分析を行うことも可能である。

Point

PatentScope はテキスト情報が原語で収録されていることに留意する必要がある。これは、名義検索をする場合には非英語（原語）の企業名も確認する必要があるということを意味する。

PatentScope の「結果分析」機能を利用すれば、ランキングや年次推移などの統計分析結果（表またはグラフ）を表示させることができ、企業動向分析に活用することができる。